

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
【部門区分】第7部門第2区分
【発行日】平成30年3月15日(2018.3.15)

【公開番号】特開2017-147294(P2017-147294A)
【公開日】平成29年8月24日(2017.8.24)
【年通号数】公開・登録公報2017-032
【出願番号】特願2016-26908(P2016-26908)
【国際特許分類】

H 0 1 L 21/027 (2006.01)

B 2 9 C 59/02 (2006.01)

【 F I 】

H 0 1 L 21/30 5 0 2 D

B 2 9 C 59/02 B

【手続補正書】
【提出日】平成30年2月5日(2018.2.5)
【手続補正1】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0071
【補正方法】変更
【補正の内容】
【0071】

図9は、第3の実施形態に係るインプリント処理を説明するための図である。図9では、ウエハWA、テンプレートT2、レジスト3などの断面図を示している。図9の(a)に示すように、インプリント工程が始まると、テンプレートT2とレジスト3とが互いに近づけられる。そして、テンプレートT2とレジスト3との接触が始まった後、図9の(b)に示すように、テンプレートT2に大きな応力変化が発生する。この場合において、テストパターン61は、テンプレートパターン62よりも強度が低いので、テストパターン61は、テンプレートパターン62よりも強い応力がかかる。したがって、テストパターン61は、テンプレートパターン62よりも弱い力で発光する。本実施形態では、テストパターン61における応力発光強度に基づいて、テンプレートT2の交換時期が判定される。